

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成22年9月2日(2010.9.2)

【公開番号】特開2009-53479(P2009-53479A)

【公開日】平成21年3月12日(2009.3.12)

【年通号数】公開・登録公報2009-010

【出願番号】特願2007-220687(P2007-220687)

【国際特許分類】

G 02 F 1/1368 (2006.01)

H 01 L 29/786 (2006.01)

【F I】

G 02 F 1/1368

H 01 L 29/78 6 1 9 B

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月14日(2010.7.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

該基板上において、互いに交差して延在すると共に遮光性の導電膜を夫々含んでなるデータ線及び走査線と、

前記データ線及び前記走査線の交差に対応して規定される画素毎に設けられた画素電極と、

前記データ線又は前記走査線の延在方向に沿ったチャネル長を有するチャネル領域、前記データ線に電気的に接続されたデータ線側ソースドレイン領域、前記画素電極に電気的に接続された画素電極側ソースドレイン領域、並びに前記チャネル領域及び前記データ線側ソースドレイン領域間に形成された第1の接合領域、前記チャネル領域及び前記画素電極側ソースドレイン領域間に形成された第2の接合領域を有する半導体層と、

前記チャネル領域にゲート絶縁膜を介して対向するように配置されたゲート電極と、

前記ゲート電極と同一層からなり、前記画素電極に電気的に接続されると共に前記画素電極側ソースドレイン領域を覆うように島状に設けられた遮光膜と

を備え、

前記第2の接合領域は、前記基板上で平面的に見て、前記データ線及び前記走査線の交差する交差領域内に少なくとも部分的に配置されている

ことを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】

前記遮光膜は、前記基板上で平面的に見て、前記チャネル領域のチャネル幅方向に沿って前記半導体層の外側に突出する突出部を有することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。

【請求項3】

前記遮光膜は、前記画素電極側ソースドレイン領域に、前記ゲート絶縁膜と同一層からなる層間絶縁膜を介して対向するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学装置。

【請求項4】

前記遮光膜は、前記画素電極側ソースドレイン領域に、前記ゲート絶縁膜と同一層からなる一の層と、前記一の層に積層された他の層とからなる層間絶縁膜を介して対向するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学装置。

【請求項5】

前記遮光膜は、前記画素電極側ソースドレイン領域に、エッチングによりパターニングする際にストップとして機能する保護膜を介して対向するように配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学装置。

【請求項6】

請求項1から5のいずれか一項に記載の電気光学装置を具備してなることを特徴とする電子機器。